《解説》

収差補正透過型電子顕微鏡によるゼオライト観察

吉田 要・佐々木優吉

一般財団法人ファインセラミックスセンター

磁場レンズの球面収差補正技術が確立したことにより電子顕微鏡の空間分解能は近年飛躍的に向上 した。しかし電子線照射損傷による制約から,ゼオライトにおいては電子顕微鏡の性能向上に観察結 果がリンクしていないのが現状である。その反面,多くの結晶性材料と比較して,ゼオライトの構造 は複雑で単純な原子カラム投影とはならないことから,原子スケールでの直接観察には非常に高い空 間分解能が要求される。そこで本稿ではわれわれの最近の研究結果をもとに,ゼオライト構造観察に おける収差補正電子顕微鏡法の有効性について解説する。球面収差補正技術では,これまでには不可 能であった負の球面収差も利用可能であり,その場合は骨格構造が非常にシャープな明るい像として 観察される。シャープな骨格像によって原子スケールに近い分解能での観察がゼオライトにおいても 可能となる。

キーワード:ゼオライト、収差補正電子顕微鏡、負球面収差イメージング、電子線損傷

1. はじめに

原子スケールでの構造情報を直接取得することが 可能な高分解能透過型電子顕微鏡(HRTEM)法は、 非常に強力な解析手法として今日の材料科学の分野 で必要不可欠な技術となっている。しかしゼオライ トは複雑な結晶構造を有している上に電子線照射損 傷による制約を大きく受けるため¹⁻³⁾,完全な原子 スケール観察というものは未だ報告がなされていな い。一方で電子光学では近年になって磁場レンズの 球面収差補正装置が実現し, 電子顕微鏡の空間分解 能を飛躍的に向上させている4-6)。収差補正のない 従来の装置の空間分解能では、ほぼ細孔とゼオライ ト骨格を分離できるまでに留まっていたが. 収差補 正電子顕微鏡 (AC-HRTEM) 法の適用によってよ り微細な構造情報の抽出が可能になると期待され る。本稿では今後更なる発展が予測されるAC-HRTEM法について、我々の最近の成果を交えつつ

受理日:2013年10月15日

〒456-8587 名古屋市熱田区六野二丁目4番1号 ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 E-mail: kaname_yoshida@jfcc.or.jp, Tel: 052-871-3500 Copyright © 2013 Japan Zeolite Association All Rights Reserved. ゼオライトを観察対象とした場合の有効性と注意点 について解説したいと思う。

2. 高分解能透過型電子顕微鏡(HRTEM)法

2.1 ゼオライト観察と電子線損傷

電子顕微鏡は光速近くまで加速された非常に波長 の短い電子線を光源として利用するため、原子ス ケール観察においても回折限界による制約を受けな い。一方で十分に波長の短いX線なども可視光に代 わる光源としてその利用が古くから試みられてい る^{7,8)}が、それらを集光可能なレンズの形成が容易 ではないため、顕微鏡法として利用は限定されてし まっているのが現状である。つまり電子顕微鏡法は 原子スケールで結晶試料内の構造観察を行えるほぼ 唯一の手法ともいえる。しかしその反面、電子顕微 鏡観察では試料が電子線との強い相互作用によって 大なり小なり損傷を受けているということに留意す る必要がある。金属材料などの場合では電子線損傷 が問題になることは稀であるが、多孔性共有結合結 晶であるゼオライトでは電子線への耐性が非常に低 いために観察時における電子線損傷が常に問題とな る。例えば高倍率な観察ほど試料にはより高密度な 電子線が照射されるため、観察可能な最大倍率は試 料の耐性によって自ずと決定されてしまう。電子線 損傷のメカニズムは非常に複雑であるために加速電 圧^{9,10)}や試料温度^{11,12)}といった要因によって複雑 に変化するが,電子線損傷を抑える上で最も肝要な ことは試料に注入される電子線の総量をとにかく抑 えることである。像取得にかかる部分の電子線量は 高感度な記録媒体によりある程度減らす事も可能で

あり,場合によっては適正露光以下で撮影した像に 適宜画像処理を加えるといったことも行う。しかし 現実問題として視野探し・試料傾斜合わせ・フォー カス合わせなどといった段階での電子線照射は無視 できないことから,観察の可否は装置の性能以上に オペレーターの手際にも大きく影響を受ける。

2.2 HRTEM法の原理

HRTEM 法は Menter による結晶格子像観察¹³⁾ に 端を発し、装置分解能の向上とともに多波合成によ る原子スケール観察法^{14,15)}へと発展したものであ る。余談ではあるが、Menterが行った初期の格子像 観察の研究は有機顔料結晶やゼオライトといった材 料が対象であり、電子線損傷が問題となる材料観察 から今日のHRTEM 法が出発していることは興味深 い点でもある。ここでHRTEM 法の原理から説明す るが、そのためには幾何光学でなく波動光学的なア プローチが必要であり、まず単純化のために試料を 弱位相物体として取り扱う。弱位相物体近似とは電 子線が試料を通過する際に電子波の振幅は変化せず 原子カラムのポテンシャルによって位相のみが僅か に変化するというものであり、非常に試料が薄い場 合でのみ成り立つ。このような僅かに受ける位相変 化によって試料出射面では透過波とπ/2の位相差を もつ散乱波とが生じる。このようにして試料から出 射する透過波と散乱波はレンズの集光作用によって 像面で収束されるが,理想光学系(無収差)では結 像される電子線の干渉パターン(像)は倍率を無視 すれば出射電子波動関数がほぼそのまま再現され. 振幅一定で位置によって位相が異なる干渉パターン (像)が形成される。しかしCCDカメラや写真フィ ルムといった電子検出器で検出されるのは強度(振 幅の二乗)分布のみであることから、結局は何も観 察されないということになる。これに対してレンズ 収差を仮想的な位相板として利用する方法を考えた のがScherzer¹⁶⁾である。まずレンズによる位相変化 量χは散乱角 θ の関数で表され、寄与が小さい高次の 収差を無視すればデフォーカス量 Δf と球面収差 C_s により(1)式のように記述される。

$$\chi(\theta) = \frac{\pi}{\lambda} \Delta f \theta^2 + \frac{\pi}{2\lambda} C_S \theta^4 \tag{1}$$

ここでλは電子線波長を示しており, Δfはアンダー フォーカス側を負の値としている。また散乱角θは 空間周波数uと波長λとの積であることから位相変 化量を空間周波数uの関数として(1')式の様に表 すことができる。

$$\chi(\theta) = \frac{\pi}{\lambda} \Delta f \theta^2 + \frac{\pi}{2\lambda} C_s \theta^4 \tag{1'}$$

これを被関数としたsin関数は位相コントラスト伝 達関数(PCTF)と呼ばれ、位相コントラストのつ き方を表す関数として便利である。

$$PCTF(u) = \sin\left(\pi\Delta f\lambda u^2 + \frac{\pi}{2}C_s\lambda^3 u^4\right)$$
(2)

理想的な位相板の条件とは散乱波のみに+ $\pi/2$ (同 位相側)もしくは $-\pi/2$ (逆位相側)の位相を付加 するものであり、Scherzerは任意の球面収差に対し てできる限り広い周波数域でこのような位相変調を あたえるようなデフォーカス設定 Δf_{Sch} を式(3)の 様に示した。

$$\Delta f_{Sch} = \begin{cases} -\sqrt{\frac{4}{3}} |C_S|\lambda & (C_S > 0) \\ \sqrt{\frac{4}{3}} |C_S|\lambda & (C_S < 0) \end{cases}$$
(3)

ただしここでは新たに負の $C_{\rm S}$ へも適用を拡張している。図1には例として典型的な200 kV TEM ($C_{\rm S}$ =+0.5 mm)におけるScherzer条件でのPCTFを示した。 この光学条件では空間周波数~5 nm⁻¹まではほ



図 1 200 kV TEM ($C_{\rm S}$ = +0.5 mm, Δf = -41 nm)の 位相コントラスト伝達関数 (実線:PCTF,破線:包絡関数,点線:減衰を含 めたPCTF)

ぼ理想的な位相板と働くが、それ以上では位相コン トラストが大きく振動してしまっていることがわか る。そのため~5 nm⁻¹以上の成分は結像に寄与し ないように対物絞りでカットされ、空間分解能が 0.2 nm (=1/(5 nm⁻¹)) に制限されるということに なる。球面収差係数はレンズ設計によりある程度小 さくすることは可能であったが、構造上の制約によ り 200 kV の場合でサブミリメートル程度が実質上 の限界となっていた。また軸対称磁場レンズの球面 収差係数は必ず正となることが既に知られており、 そのため光学顕微鏡のように組レンズによって球面 収差を打ち消す方法も電子顕微鏡においては実現が 困難であった。

2.3 球面収差補正電子顕微鏡法(AC-HRTEM)2.3.1 球面収差の最適化

近年,球面収差補正技術が確立したことにより, それまではほぼ頭打ちとなっていた電子顕微鏡の空 間分解能が飛躍的に向上した。球面収差補正装置と は非軸対称の多極子レンズを組み合わせた磁場レン ズであり,それにより形成される負の球面収差に よって対物レンズの正の球面収差を打消すというも のである。図2には収差補正の原理を幾何光学的に 模式図として示した。

収差補正装置を用いることによって球面収差をゼ ロにすることも可能であるが、HRTEM法における 位相コントラスト形成には収差による位相変調を利 用することが避けられない。従来のHRTEM法では 任意の値で固定された球面収差係数に応じてデ フォーカス値を調整し最適条件を形成していたが、



AC-HRTEM法ではデフォーカスとともに球面収差 係数も可変可能なパラメータの一つとして最適化が 必要となる。それに対してLentzenらは情報限界 g_{max} を基準とした球面収差の最適設定を提案した¹⁷⁾。 情報限界とはHRTEM像形成において可干渉領域の 最大空間周波数である。Lentzenはこのような情報 限界までの周波数に対しての位相変調と最小錯乱円 を両立させる球面収差の設定を求め、それを最適収 差 $C_{S,opt}$ とした。以下この観察条件をLentzen's C_{S} モードとよぶこととする

$$C_{\rm S, \, opt} = \pm \frac{64}{27} \frac{1}{\lambda^3 g_{\rm max}^4} \tag{4}$$

最小錯乱円とは幾何光学的取扱いでの散乱波の像面 における非局在化の大きさを示しており、その半径 Rは(5)式からもとめられる。

$$R = \left| \Delta f \lambda u + C_{\rm S} \lambda^3 u^3 \right|_{\rm max} \tag{5}$$

Lentzen's C_sモードにおける最適デフォーカスは求めた*C*_{s,opt}に対する Sherzer デフォーカスとなり,その条件下では散乱波の非局在化が最小で十分な位相コントラストを得ることができる。

一方で,球面収差を完全に補正(C_s=0)した場 合に位相変調はデフォーカスによる項のみとなり, 最適デフォーカス値は式(6)で示される。本稿で はこの観察条件をZero C_sモードとよぶこととする。

$$\Delta f_{\text{Zero}C_{\text{S}}} = \mp \lambda g_{\text{max}}^2 \tag{6}$$

2種類の観察モードではどちらも情報限界 g_{max} が 空間分解能となるが、PCTFの形状は低周波数域で 大きく異なる。表1には加速電圧200 kV,情報限界 を10 nm⁻¹としたときのそれぞれのモードでの設定 値を示し、図3に部分干渉性による減衰項を含めた それらのPCTFを示した。

それぞれのモードでの錯乱円半径は十分に小さ く,高角散乱波のにじみが観察において問題となら ないことがわかる。散乱波のにじみは界面や表面な どといった非周期部分で強く影響を受けるので,界

表1 200 kV TEM (g_{max} = 10 nm⁻¹)の光学設定と錯乱 円半径

| | 球面収差係数 | デフォーカス | 錯乱円半径 |
|-----------------------|----------------|---------|----------|
| Lentzen's $C_{\rm S}$ | $\pm 15 \mu m$ | ∓7.1 nm | 0.059 nm |
| Zero C _S | 0 µm | ∓4.0 nm | 0.10 nm |



図3 200 kV TEM $(g_{max} = 10 \text{ nm}^{-1})$ の位相コントラスト伝達関数 (a) $C_S = +15 \mu \text{m}, \Delta f = -7 \text{ nm}, (b) C_S = -15 \mu \text{m}, \Delta f = +7 \text{ nm}, (c) C_S = 0 \mu \text{m}, \Delta f = -4 \text{ nm}, (d) C_S = 0 \mu \text{m}, \Delta f = +4 \text{ nm}$ (実線:減衰を含めたPCTF, 破線:包絡関数, 点線:PCTF)

面などの精密な構造解析ではどちらのモードとも有 効に働くことが推測される。しかし一方で小さなデ フォーカス値を利用する Zero Csモードでは低周波 数領域においてその絶対値が低下していることが PCTFからは見てとることができる。低周波数成分 の像コントラストは比較的大きな周期構造をもつゼ オライトでは重要であり、空間分解能を低下させる ことなくゼオライトの十分な像コントラストを得る にはZero Csモードではなく、Lentzen's Csモードが 有効であると考えられる。

2.3.2 PCSイメージモードとNCSイメージモード 収差補正技術を用いた場合,これまでは不可能で あった負の球面収差というものも実現可能である。 既に述べているように負の球面収差を用いた場合, 正のデフォーカスつまりオーバーフォーカスが最適 値となりPCTFの符合は反転する。PCTFが正の値 となる場合,像のコントラストは反転し,原子カラ ム位置が明るいコントラストとして結像される。こ のようなイメージングモードは負球面収差(NCS) イメージング¹⁸⁻²⁰⁾と呼び,逆に正球面収差とアン ダーフォーカスによるイメージングは正球面収差 (PCS) イメージングと呼ぶ。図3で示したようにこ れらPCTFを比較すると符号が反転しているのみで あることから、単純にコントラストが反転した像が 得られるだけのようにも思われる。しかし実際の観 察では弱位相物体近似は完全には成り立たないた め、位相コントラストに加えて振幅コントラストの 寄与も考慮する必要がある。透過する電子線の振幅 は電子チャネリング効果によって原子カラム位置で 増加する。その例としてある厚さのMFI構造を透過 した200 keV電子線の位相と振幅のシミュレーショ ンを図5に示した。図4には計算に用いた単斜晶系 (a=2.0107 nm, b=1.9879 nm, c=1.3369 nm, $\beta=$ 90.67°)の構造モデル²¹⁾を示している。

ここで示す位相とは真空中を透過した場合の電子 波がもつ位相からの位相シフト量であり,透過する 試料の厚さが増加するに従って原子カラム位置での 位相シフト量が増加していることが確認できる。こ の位相シフトに応じて散乱波の振幅は増加し,それ がレンズ作用により像面での位相コントラストへと 変換されるため原子カラム位置が"明るい"もしく は"暗い"コントラストとして観察されることとな る。一方で振幅コントラストはどちらのモードにお いても原子カラム位置が明るく結像されるように寄 与するため,NCSイメージでは相乗的にコントラ ストがエンハンスされる。また位相変化パターンと



図4 (a) 単斜晶 MFI 構造モデルと(b) 投影ポテンシャル



図5 MFI 試料厚さに依存した 200 keV 電子線出射波の 位相と振幅シミュレーション

比較してチャネリングよる振幅の増加は原子カラム 位置に局在化しているため、振幅コントラストが効 果的に結像に寄与するNCSイメージでは像コント ラストが非常にシャープなものとなる²²⁾。そこで 我々はLentzen's C_Sモードを球面収差の最適設定と し、ゼオライトを観察対象とした場合のPCSおよび NCSイメージングの比較を行った。

3. 観察条件

観察試料としては市販MFI型ゼオライト(東ソー 製:HSZ-840HOA)を用いた。試料はメノウ乳鉢に より軽く粉砕を行ない,TEM用マイクログリッド 上に分散・保持した。観察は球面収差補正子(CEOS 社製:CETCOR)を装備した加速電圧200 kVの透過 型電子顕微鏡(日本電子製:JEM-2200FS)により行 なった。球面収差係数は+15 μ mまたは-15 μ mに 設定した。像記録はSlow-scan CCDカメラ(Gatan 社製:UltraScan 1000)を用いて行ない,Minimum Dose System²³⁾(MDS)の併用により試料に対する 総電子線照射量を最小限に抑えた。得られた実験像 はシミュレーション像と比較することにより定量的 解析を行った。像シミュレーションにはマルチスラ イス法²⁴⁾を用い、入力する結晶構造パラメータは 既知であるX線構造解析のデータを用いた。

4. 観察結果

4.1 実験像

図6にはMFIゼオライトのPCSおよびNCSイ メージを示した。

ゼオライトの観察では電子線量が大きく制限され るうえ収差補正によって位相コントラストは大きく 低下するため、どちらのモードにおいても生画像 (図 6a, c) は非常にノイズの多いものとなっている。 しかし、像の高速フーリエ変換(FFT)パターンに 高次スポットが現れることから、それらの像は十分 に微細な構造情報を含んでいることが確認される。 このような画像の周期性は像に含まれるランダムノ イズの除去に利用することが可能であり、図6b.c にそうしたノイズ除去を施した像を示した。処理後 の画像ではどちらのモードでの像においても従来の HRTEM法では不鮮明であった5員環や6員環の形 状までが確認されるようになっている。特に図6d に示すNCSイメージではゼオライト骨格像が非常 にシャープに結像されており、 骨格の微細構造まで が直接観察されるようになっている。このような シャープな骨格像からはペンタシル鎖の向きなども 直接判別できるため、例えばMFIとMEL構造が混 在した結晶粒などのドメイン構造が容易に解析でき ることとなる。

4.2 像シミュレーション

次に像シミュレーションとの比較により適切な観 察条件について検討を行った。図7にはデフォーカ スと試料厚さに応じたシミュレーション像を示し た。

ここで最適デフォーカス値はNCSイメージモー ドで+7nm, PCSイメージモードでは-7nmであ る。NCSイメージモードと比較するとPCSイメー ジモードでは観察条件に応じて敏感に像が変化する ことが確認される。これはPCSイメージモードにお いては振幅コントラストと位相コントラストの寄与 が逆転しているため、像パターンが観察条件に応じ



図6 MFIのAC-HRTEM像(a) PCS実験像,(b) 画像処理後のPCS像,(c) NCS実験像,(d) 画像処理後のNCS像

て複雑に変化してしまうことによるものである。つ まり試料の厚さが増すにつれて原子カラム位置での 振幅が大きくなるため、PCSイメージではある試料 厚さ以上では振幅コントラストが位相コントラスト に勝り、原子位置の中心で明るいコントラストが生 じることとなる。そのためPCSイメージモードにお いて原子カラム位置が暗いコントラストとして理想 的に結像されるのは、非常に薄い(<~4 nm) 試料 を最適デフォーカスで観察した場合に限られる。シ ミュレーションとの比較から図6で示したPCSイ メージは厚さ4nmの試料を最適デフォーカスで観 察したものであるとわかる。一方、NCSイメージ シミュレーションの場合では観察条件による像変化 は非常に緩やかとなっており、フォーカス合わせに おいて要求される厳密さが幾分緩和されることを示 している。非常にシグナル強度の低い像によって フォーカス合わせを行うゼオライトでは厳密な フォーカス合わせが困難であることから、NCSイ メージングモードではより構造像を得やすいという

利点を有することが考えられる。ただし最適デ フォーカス条件のNCSイメージングモードにおい ても試料厚さが増すにつれ骨格内の微細なコントラ ストは原子カラム位置から外れてしまうため、NCS イメージモードにおいても試料厚さは可能な限り薄 い方が良い。実際、図6に示すNCSイメージはシ ミュレーション像との比較により、試料厚さが4 nm 程度の非常に薄いサンプルであることが確認され る。

5. おわりに

観察および像シミュレーションによる解析の結 果,ゼオライト観察の高分解能化にAC-HRTEM法 が非常に有効であることが確認された。またゼオラ イト骨格の微細構造解析にはPCSイメージモード に比べてシャープな原子カラム像を与えるNCSイ メージモードはゼオライト骨格内のポテンシャルの 可視化に有利であることが確認された。NCSイメー ジング法はゼオライト骨格のみならずカウンターカ



図7 200 kV TEMのMFIシミュレーション像 (a) $C_{\rm S} = +15 \,\mu {\rm m}$, (b) $C_{\rm S} = -15 \,\mu {\rm m}$

チオンの直接観察にも有効であり、我々は最近A型 ゼオライトに吸着したセシウムイオンの直接観察に 成功し報告²⁵⁾している。しかし一方で収差補正に よりゼオライト観察像における位相コントラストは 大きく低下しているため, 微細構造を明瞭に可視化 するためには画像処理が必須となってしまってい る。そのため画像処理を必要としないより確かな像 を取得することが今後の課題であろうと考えられ, そのような問題を解決するアプローチとしては像記 録の高感度化と高コントラスト結像法の開発が有効 となる。高感度な記録媒体の開発という点では、電 子を直接カウントすることが可能なCMOS検出器²⁸⁾ なども近年市販化されており、今後のカメラの性能 向上によるゼオライト観察の高度化が大きく期待さ れている。しかし一方で、高コントラスト化という 点ではレンズ収差による位相コントラスト形成では 限界があり、理想的な位相板の開発が最も有効であ ると考えられる²⁶⁻²⁸⁾。現状では電子位相板はチャー ジアップ、コンタミネーションや工作精度の問題か ら高分解能観察が可能なほどの精度には達していな いが、それらが解決されるようになれば高分解能・ 高コントラストでのゼオライト観察手法として大き な可能性を秘めているものと期待される。

また本稿ではふれなかったが、収差補正技術が確 立して以降、HRTEM法以上に走査型電子顕微鏡 (STEM)法が電子顕微鏡技術として大きく進展を 果たしてきている。その理由としては非干渉性結像 モードでの像解釈の容易さや分光装置などとの相性 の良さが挙げられ、そういった特徴からゼオライト においても有効な観察手法^{29,30)}の一つとなり得る。 しかしSTEM観察では収束された強烈な電子プロー ブが試料上を走査されるため、耐性が低いサンプル では不利もしくは全く観察ができないといった場合 も出てくる。つまりSTEM観察では電子線損傷に よって対象試料が大きく限定されてしまう点を考慮 すると、ゼオライト構造解析においてはHRTEM法 の更なる発展が今後も重要となってくる。ただし両 手法には電子線損傷以外でも多くの長所・短所があ るため, 試料の耐性によっては観察手法を目的に対 してうまく合わせていくことが必要とされる。

謝 辞

本研究の一部は,独立行政法人新エネルギー・産 業技術総合開発機構(NEDO)「規則性ナノ多孔体 精密分離膜部材基盤技術の開発」の委託業務の結果 得られたものである。また本研究の一部は文部科学 省ナノテクノロジープラットフォーム事業(京都大 学微細構造解析プラットフォーム)の支援を受けて 実施されました。また京都大学化学研究所倉田博基 教授にはAC-HRTEM法について有益なご議論をい ただきました。

文 献

- 1) O. Terasaki and T. Ohsuna, Catalysis Today, 23, 201 (1995).
- R. Csencsits and R. Gronsky, Ultramicroscopy, 23, 421 (1987).
- Y. Yokota, H. Hashimoto and T. Yamaguchi, *Ultramicroscopy*, 54, 207 (1994).
- M. Haider, H. Rose, S. Uhlemann, B. Kabius and K. Urban, J. Electron Microsc., 47, 395 (1998).
- M. Haider, H. Rose, S. Uhlemann, E. Schwan, B. Kabius and K. Urban, *Ultramicroscopy*, 75, 53 (1998).
- M. Haider, S. Uhlemann, E. Schwan, H. Rose, B. Kabius and K. Urban, *Nature*, **392**, 768 (1998).
- K. Yada and S. Takahashi, J. Electron Microsc., 38, 321 (1989).
- H. Yoshimura, D. Shoutsu, T. Horikoshi, H. Chiba, S. Kumagai, K. Takahashi and T. Mitsui, *J. Electron Microsc.*, 49, 621 (2000)
- 9) K. Yoshida and Y. Sasaki, *Microscopy*, **62**, 369 (2013).
- 10) R. F. Egerton, Ultramicroscopy, 127, 100 (2013).

- B. E. Bammes, J. Jakana, M. F. Schmid and W. Chiu, J. Struct. Biol., 169, 331 (2010).
- 12) J. Dubochet, E. Knapek and I. Dietrich, *Ultramicroscopy*, 6, 77 (1981).
- 13) J. W. Menter, Proc. Roy. Soc., A236, 119 (1956).
- 14) S. Iijima, Acta Cryst., A31, 784 (1975).
- N. Uyeda, K. Kobayashi, K. Ishizuka and Y. Fujiyoshi, *Chemica Scripta*, 14, 47 (1978–1979).
- 16) O. Scherzer, J. Appl. Phys., 20, 20 (1949).
- M. Lentzen, B. Jahnen, C. L. Jia, A. Thust, K. Tillmann and K. Urban, *Ultramicroscopy*, 92, 233 (2002).
- C. L. Jia, M. Lentzen and K. Urban, Science, 299, 870 (2003).
- 19) C. L. Jia and K. Urban, *Science*, **303**, 2001 (2004).
- C. L. Jia, L. Houben, A. Thust, J. Barthel, *Ultramicroscopy*, 110, 500 (2010).
- H. van Koningsveld, J. C. Jansen and H. van Bekkun, Zeolites, 10, 235 (1990).
- 22) K. Yoshida, Y. Sasaki and H. Kurata, *AIP Advances*, 3, 042113 (2013).
- Y. Fujiyoshi, T. Kobayashi, K. Ishizuka, N. Uyeda, Y. Ishida and Y. Harada, *Ultramicroscopy*, 5, 459 (1980).
- 24) J. M. Cowley and A. F. Moodie, Acta Cryst., 10. 609 (1957).
- 25) K. Yoshida, K. Toyoura, K. Matsunaga, A. Nakahira, H. Kurata, Y. H. Ikuhara and Y. Sasaki, *Sci. Rep.*, **3**, 02457 (2013).
- 26) K. Nagayama, Eur. Biophys. J., 37, 345 (2008).
- 27) E. Majorovits, B. Barton, K. Schultheiß, F. Pérez-Willard, D. Gerthsen and R. R. Schröder, *Ultramicroscopy*, **107**, 213 (2007).
- 28) B. E. Bammes, R. H. Rochat, J. Jakana, D.-H. Chen and W. Chiu, J. Struct. Biol., 177, 589 (2012).
- A. Mayoral, J. Coronas, C. Casado, C. Tellez and Isabel Díaz, ChemCatChem, 5, 2595 (2013).
- A. Mayoral, T. Carey, P. A. Anderson, A. Lubk and Isabel Díaz, *Zeolites*, 50, 11230 (2011).

High-resolution Imaging of Zeolitic Frameworks with Aberration Corrected Transmission Microscope

Kaname Yoshida and Yukichi Sasaki

Japan Fine Ceramics Center

We demonstrated high-resolution imaging of zeolitic frameworks with spherical aberration corrected transmission electron microscopy (AC-HRTEM). Some types of zeolitic framework were observed by AC-HRTEM under the optimal optical conditions. Compared with the conventional imaging mode based on a positive spherical aberration and under-defocus, the negative spherical aberration (NCS) imaging mode brought bright sharper framework image. The amplitude contrast localized at atomic column positions contribute to enhancement of image contrast in NCS image synergistically with bright phase contrast. Since the projected atomic structure of zeolites are very complex, distinct image of zeolitic framework can help to distinguish each atomic column position.

Key words: zeolites, aberration-corrected TEM, negative Cs imaging, electron irradiation damage

Copyright © 2013 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.